CdS/CdTe 薄膜太阳电池的深能级瞬态 谱和光致发光研究*

黎 兵 刘 才 冯良桓 张静全 郑家贵 蔡亚平

蔡伟 武莉莉 李卫 雷 智 曾广根 夏庚培

(四川大学材料科学与工程学院,成都 610064) (2008年7月14日收到 2008年8月17日收到修改稿)

用深能级瞬态谱和光致发光研究了无背接触层的 CdS/CdTe 薄膜太阳电池的杂质分布和深能级中心.得到了净 掺杂浓度在器件中的分布.确定了两个能级位置分别在 $E_v + 0.365 \text{ eV}$ 和 $E_v + 0.282 \text{ eV}$ 的深中心,它们的浓度分别 为 $1.67 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 和 $3.86 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$,俘获截面分别为 $1.43 \times 10^{-14} \text{ cm}^2$ 和 $1.53 \times 10^{-16} \text{ cm}^2$.它们来源于以化学杂质 形式存在的 Au 和(或)Te_{Ca}⁻²复合体,或与氩氧气氛下沉积 CdTe 时的氧原子相关.

关键词:深能级瞬态谱,光致发光,CdS/CdTe太阳电池 PACC:7360L,7855,7340L

1.引 言

CdS/CdTe 多晶薄膜太阳电池制作成本低、工艺 简单、转换效率高,是目前大规模地面应用中最有前 景的薄膜太阳电池之一.它在国外已商业化生产,大 面积组件转换效率约为9%^[1];国内已由四川大学 太阳能材料与器件研究所建成了第一条中试生产 线,制作的大面积(300 mm×400 mm)电池组件效率 超过8%.单晶CdTe 太阳电池的理论转换效率接近 30%^[2],国际上小面积CdTe 多晶薄膜太阳电池最高 转换效率为16.5%^[3],国内最高水平为13.38%^[4].

限制 CdS/CdTe 太阳电池效率的原因主要 有^[5-9]:1)与 CdS/CdTe 结界面相关的复合损失;2)对 CdTe 层的可控掺杂比较困难;3)在 CdTe 表面难以 获得低的接触电阻;4)背接触的退化.这几点都与深 能级中心相关.深中心能够俘获光生载流子,造成输 出电流损失,影响能带结构,降低开路电压,降低电 池效率^[10].所以,对器件中的深中心缺陷进行研究 显得很有必要.

在各种表征深能级中心的方法中,深能级瞬态 谱(deep level transient spectroscopy, DLTS)的应用最 广泛,它由Lang在结电容技术^[11]基础上发明.它测 试速度快,能量分辨率高,可获信息多,应用范围广. 详细原理可参考文献,12,13].

国外研究机构对 CdTe 薄膜太阳电池的深 能级中心作了一些基础研究^[10,14-23],集中在退火、 制作背接触层的影响等方面;国内尚未见相关报 道.本文用 C-V 法、深能级瞬态谱、恒温深能 级瞬态谱(isothermal DLTS, IDLTS)和光致发光 (photoluminenscence, PL)研究了 CdS/CdTe 太阳电池 中的杂质分布和深能级中心,确定了两个深中心的 能级位置,并讨论了它们的来源.

2. 实验部分

2.1. 样品制备

本文研究的器件结构为 Glass/TCO/CdS/CdTe/ Au.用化学水浴法沉积 CdS 薄膜,用近空间升华法 于氩氧气氛下沉积 CdTe 薄膜.经 CdCl₂ 处理后的样 品在干燥空气气氛下,于 400℃退火.CdS 与 CdTe 的 厚度分别为 100 nm 和 8 µm.在制作金电极之前,用 溴甲醇溶液对样品进行腐蚀.得到面积为 12.56

^{*}国家高技术研究发展计划(863)(批准号 2003 AA513010)国家自然科学基金(批准号 50506004) 资助的课题.

mm² 的没有背接触层的 CdS/CdTe 薄膜太阳电池.

2.2. 样品测试

用 DLTS 和 IDLTS 对样品进行深能级瞬态谱的 测量.本实验所采用的 DLS-83D 型深能级瞬态谱仪 由匈牙利 SEMILAB 公司生产.进行深中心测量前, 分别对样品进行光 *I-V* 暗 *C-V* 测量,以获得器件的 性能、净掺杂浓度(*N*_A-*N*_D)和内建电势 *U*_B,它们将 参与计算深中心的相关参数.

光致发光谱的测量采用 Hitachi 公司制造的 F-7000 荧光光谱仪.

3. 结果与讨论

3.1. 光 I-V 和暗 C-V 测试

光 *I-V* 测量得到电池的开路电压为 752 mV,短路电流密度 23.0 mA·cm⁻²,填充因子 51.5%,转换效率 8.94%.



图 1 暗 C-V 特性和 1/C²-V 曲线

 $U_{\rm B}$ 和($N_{\rm A}$ - $N_{\rm D}$)通过常温下的暗 *C*-*V*测试来确 定.图1为样品的 *C*-*V*和1/*C*²-*V*曲线.从1/*C*²-*V*曲 线中可拟合出两个斜率.在正向偏压较大部分计算 出的($N_{\rm A} - N_{\rm D}$)为2.3×10¹⁵ cm⁻²,对应于 CdTe 层体 净掺杂浓度;零偏压附近的($N_{\rm A}$ - $N_{\rm D}$)为1.2×10¹³ cm⁻² 对应于 CdS/CdTe 结界面附近的净掺杂浓度. 在 *C*-*V*测试中 随着偏压的变化,可以直接得到净掺 杂浓度随结深度的分布.其结果与图1计算的结果一 致.一般来讲,CdTe 薄膜的体净掺杂浓度比结界面附 近高1—3个数量级.净掺杂浓度随结深度的变化,说 明离子化杂质在耗尽层中的浓度分布不同,随着结深 的增加而升高.CdS/CdTe 结界面处净掺杂浓度的降 低,说明那里存在由深施主杂质等补偿而形成的高界 面态密度^[14].器件的内建电势为 0.48 V.

3.2. DLTS 测试

3.2.1. 计算公式

深能级中心的浓度 N_T 由下式确定:

$$N_{\rm T} = 2 \frac{\Delta C}{C_0} (N_{\rm A} - N_{\rm D}) \left(\frac{x_{\rm d}^2}{x_1^2 - x_2^2} \right) , \qquad (1)$$

其中 ΔC 为瞬态电容信号, C_0 为反向偏压 V_{bias} 下的 电容值. x_{d} 为耗尽层宽度, x_1 , x_2 分别为反向偏压和 正向脉冲 V_{puls} 下深中心能级与费米能级的交点 位置.

深中心的能级位置 E_{T} 由 Arrhenius 曲线确定. 以 n^+p 结为例 ,有下式成立:

$$\ln \frac{e_{\rm p}}{T^2} = \ln B_{\rm p} - \frac{E_{\rm T} - E_{\rm V}}{kT} , \qquad (2)$$

其中 e_p 为空穴陷阱的发射率 B_p 为包含俘获截面 σ_p 且与温度无关的项 $\ln(e_p/T^2)$ 对 1/T 的曲线即为 Arrhenius 曲线 ,通过计算其斜率即可确定 E_T ,由截 距即可算出深中心的俘获截面 σ_p .

器件中 n 型 CdS 层可视为高掺杂,与 p 型 CdTe 层形成 n⁺ p 结,符合 DLTS 的理论模型,获得的信息 主要来自 CdS/CdTe 结耗尽层中 p 型 CdTe 部分.由 于没有制作背接触层,CdTe 与金属电极之间可能形 成肖特基势垒^[4],使欧姆接触不太理想^[24],在一定 程度上不利于测试.

3.2.2. 测试结果

恒频下温度扫描的 DLTS 谱如图 2 所示,峰所对 应的深中心被称为 H₁,属于空穴陷阱,其相关参数 见表 1.

与 2500 Hz 下的曲线相比 250 Hz 和 25 Hz 的曲 线有一些不规则跳跃的点.为了确定这些点是否为 有效的深能级信号,在测试过程中同步记录了样品 电容随温度变化的曲线,如图 3.样品电容是深能级 瞬态谱信号的输入信号,电容值发生跳变的时候 DLTS 输出信号也发生跳变.从信号跳变的不规则性 判定它们不是有效输出信号.经过多次对同一样品 和不同样品的测量,发现低频(~10 Hz)下 DLTS 输 出信号的稳定性和平滑度明显差于高频(~10³ Hz) 下的.这是因为能级深度较浅(<400 meV)的深中心 对低频率窗值响应较差而对高频响应较好.根据深 能级瞬态谱原理,这种选择性响应使低频下此类深 中心贡献的电容信号输入不稳定,使 DLTS 信号不



图 2 DLTS 曲线(V_{bias} = -0.3 V,V_{puls} = 1.8 V,脉冲宽度 20 µs, 升温速率 0.2 K/s)

规则跳跃.这也是当初 Lang 采用高频(~10°Hz)进 行深中心测量的原因,并直接导致了 DLTS 技术的 发明^[25].为了获得更多能级深度相对较浅的深中心 信息,DLTS测试采用的频率一般为 10³—10°Hz,远 高于之前的结电容技术的频率,所以没看到其他作 者报道这个现象.



图 3 电容-温度特性曲线

为了得到更多的深中心信息,还进行了 IDLTS 测量,谱线如图4所示.得到了一个深能级中心,被 称为H₂,同样是空穴陷阱,参数详见表1.H₁和H₂ 的 Arrhenius 曲线如图 5 所示.

表 1	深中心参数总约	+

名称	$E_{\rm T}/{\rm eV}$	$N_{\rm T}/{\rm cm}^{-2}$	$\sigma/{\rm cm}^2$
H_1	$E_{\rm V} + 0.365$	1.67×10^{12}	1.43×10^{-14}
H_2	$E_{\rm V}+0.282$	3.86×10^{11}	1.53×10^{-16}

3.2.3. H₁ 和 H₂ 的来源

由于样品没制作背接触层,深中心可能由如下 几个原因引入:CdTe 在氩氧气氛下的沉积;CdCl₂处



图 4 IDLTS 曲线 V_{bias} = -0.3 V, V_{puls} = 2.4 V, 脉冲宽度 20 µs, 频率 1.066—2500 Hz)



图 5 H₁和 H₂的 Arrhenius 曲线

理及在空气中的退火;腐蚀;多晶 CdTe 的 Cd 或 Te 空位及其与卤素原子形成的复合体 /金属背电极等。 为了进一步探究这两个深中心的来源,我们与相关 文献进行了对照.Komin 等人的工作显示^[17],退火过 程中氧的存在没有引入具有电活性的缺陷,或者其 浓度低于此技术的探测下限.Versluys 等人的研究中 没有得到与本文Hu和Hu能级位置相同的深中 $心^{[10,15-21]}$.他们一般把能级位置处于 E_v +(0.27— 0.35 JeV 的深中心归结为因制作以 Cu 为基础的背 接触层而引入的与 Cu 相关的缺陷^{16 20 22}].化学杂质 如 Ag ,Au 或带单电荷的碲空位 Teca也可能引入这个 能级范围的缺陷^[22]. Isett 的研究^[23]中得到了两个与 本文结果很接近的深中心(E_v + 0.28 eV 和 E_v + 0.35 eV). 他研究的样品没有进行 CdCl, 处理和退 火 所以这两个缺陷与 Cl 原子无关,排除它与空位 原子形成复合体缺陷而引入 H₁ 和 H₂ 的可能.由于 本文中样品没有制作背接触层,不存在 Cu 引入的 缺陷,所以这两个缺陷很可能是由以化学杂质的形 式存在的 Au 和(或)Te_{ca}复合体引入.至于沉积 CdTe 时氩氧气氛中的氧能否引入这个能级范围的缺陷, 没有见到相关报道,有待进一步研究. Balcioglu^[14]在 研究以掺杂石墨(掺杂元素为 HgTe :Cu)为背接触层 的电池中发现了两个深中心($E_c = 0.28$ eV 和 E_v + 0.35 eV),前者是与(Cu_i⁺⁺)相关的复合体,后者是 Cu 间隙原子.

3.3. 光致发光谱

光致发光也是研究半导体杂质和缺陷的有力手 段^[13].有人在低温(10 K)下对经 CdCl₂处理退火后 的 CdTe 电池的 PL 谱进行了研究^[26,27]本文的 PL 谱 在 290 K 下获得.

PL 谱的激发光波长为 238 nm(5.22 eV) 远大于 室温下 CdTe 和 CdS 的禁带宽度(1.50 eV 和 2.45 eV)这可能导致激发光被薄膜强烈吸收,使带间吸 收占主要部分,结界面和 CdTe 膜表面的 PL 谱如图 6 所示,由于存在大量的缺陷态,结界面只有一个处 在 3.17 eV 高而宽的峰; 10 K 下的结界面 PL 谱 中^[26] 真空退火的样品仅在 1.40 eV 处有一高而宽 的峰,空气中退火的样品除了 1.40 eV 处的峰之外, 还有 1.48 eV 和 1.55 eV 两处小而锐的峰.1.40 eV 处的峰被认为是与 Cl 原子相关的施主所引起的发 射 很可能此处 3.17 eV 的峰是由同一发射机理产 生,而其他弱峰受声子剧烈振动的影响而被掩盖.在 CdTe 薄膜表面的 PL 谱中, 有多个发射峰, 室温下各 种发射机理的峰相互叠加,难以一一分辨.可能包括 如下机理²⁶]:卤素原子(Cl)与Cd空位形成受主中 心发射 ;与氧相关的施主-受主对跃迁 ,氧处于 Te 原 子位置或是 TeO, 形式;发射峰处于 1.59 eV 处的激 子复合发射^[27]等等。



图 6 PL 谱 (a)结界面 (b)CdTe 膜面

从 DLTS 和 PL 谱的结果来看,它们有部分相同的缺陷机理,例如 Cl 原子与 Cd 空位形成复合体等. 由于各自的局限,它们的结果不能形成明确的对应和相互印证关系.例如光致发光不能有效探测非辐射中心,DLTS 因测试温度和率窗频率范围限制,测量结果不一定能覆盖样品中的所有缺陷,也不一定能覆盖光致发光得到的结果.正因如此,二者的结果可互为补充.

4.结 论

以化学杂质形式存在的 Au 和(或) Te_{ca} 复合体 等可以引入能级位置分别在 E_v + 0.282 eV 和 E_v + 0.365 eV 的两个深能级中心;同时,不能排除沉积 CdTe 时氧的存在引入这些缺陷的可能.此外,制作 不同的背接触层对深中心分布的影响是今后研究的 重点.光致发光谱获得了一些杂质和缺陷信息,与 DLTS 的结果互补,但不能形成明确的对应关系.

- [1] Bonnet D , Meyers P 1998 J. Mater . Res . 13 740
- [2] Chu T I, Chu S S, Ferekides C G 1992 J. Cryst. Growth 117 1073
- [3] Wu X 2004 Solar Energy 77 803
- [4] He J X, Zheng J G, Li W, Feng L H, Cai W, Cai Y P, Zhang J Q, Li B, Lei Z, Wu L L, Wang W W 2007 Acta Phys. Sin. 56 5548 (in Chinese)[贺剑雄、郑家贵、李 卫、冯良桓、蔡 伟、蔡亚平、张静全、黎 兵、雷 智、武莉莉、王文武 2007 物理 学报 56 5548]
- [5] Chou H C , A Rohatgi , Jokerst N M , Thomas E W , Karma S 1996 J. Electron. Mater. 25 1093
- [6] Morgan D , Tang J , Kaydanov V , Ohno T R , Trefny J U 1998 NCPV Photovoltaics Review Program Review Proceedings of the 15th Conference (Denvor: AIP) p200
- [7] Bube R H 1998 Photovoltaic Materials (London : Imperial College Press)
- [8] Song H J, Zheng J G, Feng L H, Cai W, Cai Y P, Zhang J Q, Li W, Li B, Wu L L, Lei Z, Yan Q 2007 Acta Phys. Sin. 56 1655
 (in Chinese)[宋慧瑾、郑家贵、冯良桓、蔡 伟、蔡亚平、张静 全、李 卫、黎 兵、武莉莉、雷 智、焉 强 2007 物理学报 56 1655]

- [9] Li Q , Zheng Y F , Zhou X L , Sun Y F , Jian J K 2008 Acta Phys. Sin. 57 3880 (in Chinese)[李 茜、郑毓峰、周向玲、孙言飞、 简基康 2008 物理学报 57 3880]
- [10] Versluys J , Clauws P , Nollet P , Degrave S , Burgelman M 2004 Thin Solid Films 451-452 434
- [11] Lang D V 1974 J. Appl. Phys. 45 3023
- [12] Sah C T 1970 Solid State Electronics 13 759
- [13] Xu Z J 2007 Examination and Analysis of Semiconductor (Beijing : Science Press) p583, 201 (in Chinese) [许振嘉 2007 半导体的 检测与分析(北京 科学出版社) 第 583 201 页]
- [14] Balcioglu A, Ahrenkiel R K, Hasoon F 2000 J. Appl. Phys. 88 7175
- [15] Reislöhner U, Hädrich M, Lorenz N, Metzner H, Witthuhn W 2007 Thin Solid Films 515 6175
- [16] Komin V , Viswanathan V , Tetali B , Morel D L , Ferekides C S 2002 Proceedings of the 29th IEEE Photovoltaic Specialists Conference 736
- [17] Komin V, Tetali B, Viswanathan V, Yu S, Morel DL, Ferekides C S 2003 Thin Solid Films 431 143
- [18] Komin V, Viswanathan V, Tetali B, Morel DL, Ferekides CS 2000

Proceedings of 28th IEEE Photovoltaic Specialists Conference 676

- [19] Versluys J , Clauws P , Nollet P , Degrave S , Burgelman M 2003 Thin Solid Films 431-432 148
- [20] Habibe Bayhan 2004 J. Phys. Chem. Solid 65 1817
- Lourenço M A , Yip Kum Yew , Homewood K P , Durose K , Richter [21] H , Bonnet D 1997 J. Appl. Phys. 82 1423
- [22] Samimi M, Biglari B, Hage-Ali M, Koebel J M, Siffert P 1989 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 283 243
- [23] Isett L C 1984 J. Appl. Phys. 56 3508
- [24] Yang XW, Zheng JG, Zhang JQ, Feng LH, Cai W, Cai YP, Li W, Li B, Lei Z, Wu L L 2006 Acta Phys. Sin. 55 2504 (in Chinese)[杨学文、郑家贵、张静全、冯良桓、蔡 伟、蔡亚平、 李 卫、黎 兵、雷 智、武莉莉 2006 物理学报 55 2504]
- [25] Lang D V 2007 Physica B 401-402 7
- [26] Gheluwe J V , Versluys J J , Poelman D , Clauws P 2005 Thin Solid Films 480 264
- [27] Wu L L , Feng L H , Cai W , Zhang J Q , Cai Y P , Zheng J G , Zhu J M , Chen N F 2003 Chinese Journal of Semiconducetor 24 827(in Chinese)[武莉莉、冯良桓、蔡伟、张静全、蔡亚平、郑家贵、 朱居木、陈诺夫 2003 半导体学报 24 827]

Deep level transient spectroscopy and photoluminescence studies of CdS/CdTe thin film solar cells *

Li Bing Liu Cai Feng Liang-Huan Zhang Jing-Quan Zheng Jia-Gui Cai Ya-Ping Cai Wei

Wu Li-Li Li Wei Lei Zhi Zeng Guang-Gen Xia Geng-Pei

(College of Materials Science and Engineering , Sichuan University , Chengdu 610064 , China)

(Received 14 July 2008; revised manuscript received 17 August 2008)

Abstract

Impurities and deep levels in CdS/CdTe thin film solar cells with no back-contact layer were studied by deep level transient spectroscopy and photoluminescence. They could lower the device performance notably. Distribution of net carrier concentration was obtained. Two deep levels at $E_V + 0.365$ eV and $E_V + 0.282$ eV were determined with concentration of 1.67×10^{12} cm⁻³ and 3.86×10^{11} cm⁻³, respectively, and with capture cross section of 1.43×10^{-14} cm² and 1.53×10^{-16} cm², respectively. They are attributed to chemical impurities like Au and/or a singly charged tellurium vacancy complex, or related to O atoms introduced by the deposition of CdTe in O2 and Ar ambient.

Keywords : deep level transient spectroscopy , photoluminesence , CdTe solar cells PACC: 7360L, 7855, 7340L

1991

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60506004) and the National High Technology Research and Development Program of China (Grant No. 2003AA513010).